

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 10 月 26 日(26.10.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/144388 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/22 (2012.01) C09J 167/00 (2006.01)
B24B 37/20 (2012.01) H01L 21/304 (2006.01)
C09J 163/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/059910
- (22) 国際出願日: 2012 年 4 月 11 日(11.04.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-095270 2011 年 4 月 21 日(21.04.2011) JP
特願 2011-197277 2011 年 9 月 9 日(09.09.2011) JP
特願 2012-084023 2012 年 4 月 2 日(02.04.2012) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東洋
ゴム工業株式会社(TOYO TIRE & RUBBER CO.,
LTD.) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀
1 丁目 1 7 番 1 8 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 数野 淳
(KAZUNO, Atsushi) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪
市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工
業株式会社内 Osaka (JP). 中村 賢治 (NA-
KAMURA, Kenji) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市

西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業
株式会社内 Osaka (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人 ユニアス国際特許事務
所 (UNIUS PATENT ATTORNEYS OFFICE); 〒
5320011 大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 1 3
- 9 新大阪MTビル 1 号館 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS,
KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA,
RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV,
SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,
VN, ZA, ZM, ZW.

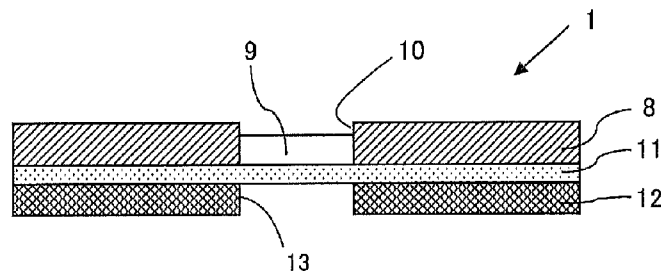
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ユー
ロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[続葉有]

(54) Title: LAMINATED POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 積層研磨パッド

【図2】



(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide a long-lived laminated polishing pad wherein a polishing layer is resistant to detachment from a support layer even when high temperatures are produced by long periods of polishing. This laminated polishing pad is characterized in that: a polishing layer and a support layer are laminated together with an adhesive member interposed therebetween; said adhesive member is either an adhesive layer containing a polyester-based hot-melt adhesive or double-sided tape that has one of such adhesive layers on each side of a substrate; and for each 100 weight parts of a polyester-resin base polymer, said polyester-based hot-melt adhesive contains 2 to 10 weight parts of an epoxy resin that has at least two glycidyl groups per molecule.

(57) 要約: 本発明は、長時間の研磨により高温になる場合であっても研磨層と支持層との間で剥離しにくい長寿命の積層研磨パッドを提供することを目的とする。本発明の積層研磨パッドは、研磨層と支持層とが接着部材を介して積層されており、前記接着部材は、ポリエステル系ホットメルト接着剤を含む接着剤層、又は基材の両面に前記接着剤層を有する両面テープであり、前記ポリエステル系ホットメルト接着剤は、ベースポリマーであるポリエステル樹脂 100 重量部に対して、1 分子中にグリシジル基を 2 つ以上有するエポキシ樹脂を 2 ～ 10 重量部含有することを特徴とする。

WO 2012/144388 A1